

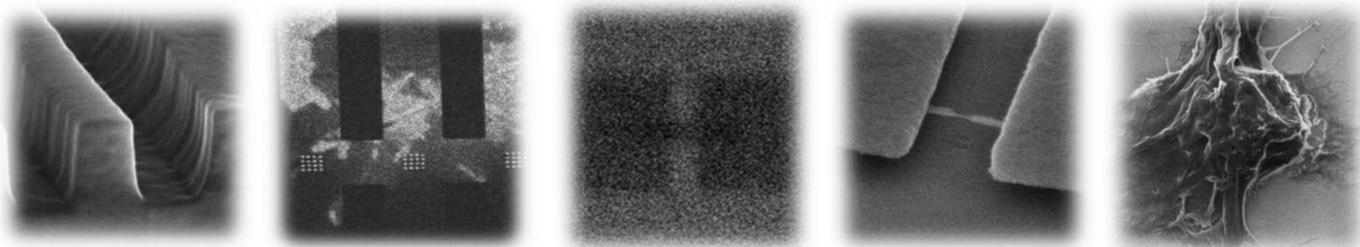
第78回応用物理学会秋季学術講演会 シンポジウム

GFIS (電界電離ガスイオン源)・先端イオン源顕微鏡技術とその材料・
デバイス研究開発への応用

2017年9月7日(木) 13:45 ~ 18:30 会場 C13 福岡国際会議場

ヘリウムイオン顕微鏡に代表されるGFIS顕微鏡、先端イオン顕微鏡技術を語るシンポジウムです。まだまだ若く、けれども古い技術、温故知新、何に使える何ができるか、エレクトロニクス、ナノ工学、ライフサイエンス、その他多くの分野の方々とその可能性を探りましょう。この道のパイオニアにその想いを面白く語って頂きます。一緒に楽しみ明日のイオン顕微鏡技術を拓きましょう！

1. Welcome to the symposium on recent GFIS/advanced ion source microscopy
Shinichi Ogawa (AIST)
2. Effect of surface condition on ion induced secondary electron contrast in carbon-based samples
Marek E. Schmidt (JAIST)
3. The Physics of Helium Ion Nanofabrication
William B. Thompson (HeEllonics LLC)
4. Single-nanometer graphene patterning with helium ion beam for extreme sensing and phonon engineering applications
Hiroshi Mizuta (JAIST)
5. Nanopore Fabrication to Two-dimensional Crystals by Adjusting Dose and focus of Helium Ion Microscope
Kentaro Kawai (Osaka Univ.)
6. Spatially controlled formation of nanostructures for magnetic and electronic applications
Gegor Hlawacek (Helmholtz-Zentrum)
7. Development of scanning ion microscope with H_3^+ Gas field ionization ion source
Shinichi Matsubara (Hitachi)
8. Three-dimensional nanofabrication technology using focused-ion-beam
Reo Kometani (Univ. of Tokyo)
9. Mechanical reliability of FIB-fabricated Si-Related Materials
Takahiro Namazu (Aichi Inst. Tech.)
- 10. Late-Breaking**
The Neon Gas Field Ion Source: New Challenges and New Opportunities
John Notte (Carl Zeiss)



世話人:小川真一(産総研)、水田博(北陸先端大)、米谷玲皇(東大)